

非連續の変革 未来創る

大日本印刷 ⑪

挑戦する企業

「フォトマスクの外販メーカーとして、トップに返り咲きたい」。大日本印刷（DNP）常務執行役員の中西稔は夢を語る。同社は日本の半導体業界の黎明（れいめい）期からフォトマスク（半導体回路の原版）を開発・生産し、世界トップ級のシェアを持つ。最先端の極端紫外線（EUV）マスクや、ハイエンドからローエンドまで手がける光マスク、ナノインプリンタリソグラフィ

フォトマスク 再びトップに

品質妥協せずに技術磨く

—(N.I.L.) 装置向けテンプレートなど、顧客の多様なニーズに応える全方位戦略で挑む。

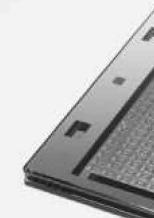
EUVで脚光

DNPは1960年ごろ、IC（集積回路）の伸長を見据えてフォトマ

DNPは2000年ごろに始めた最先端のEUVマスクの開発を一時中断

クの二一ツの見通しは、や
たない中、技術者が「満
足のいくEUVマスクが

「ガラスコアの事業化を目指し、25年3月に新光電気工業に出資した。平たん性や剛性が必要な大型パッケージ向けに開発を進める。」
「必要な技術を先回りで得、明日が来たらモノを作りたい」という人的情熱が勝つのだと思動した」（中西）。



スクの開発に着手し、61年に量産技術を確立。検査装置メーカーなどと協働し、日本でのサプライチェーン（供給網）を構築した。位相シフト技術の開発にも携わり、半導体の微細化に貢献した。だが、日本の電機メー

「再び最先端へ」。同社のEUVマスク開発には16年ごろだが、後の半導体メーカーからの大型受注を契機に徐々に業績が上向いた。

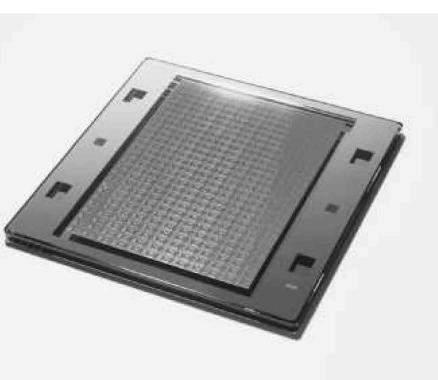
であるまで開発を続けた
い」と役員に直談判した。
その後、DNPのEU
Vマスクの技術力は向
上。27年度には国内で2
ノット(チノは10億分の1)
世代のロジック半導体向
けEUVマスクの量産を
目指す。「最後は『良い

動した】（中西）。

全方位の開発

現在の半導体市場はA I（人工知能）向けで活況だ。DNPは変化に強い全方位戦略で臨む。E UVマスク・光マスクの生産能力増強に加えて、

「必要な技術を先回りして磨き、潮目が来たらタイムリーに提供できるようになることが大事。EUVマスクではそれができた」（同）。技術者の思いも根強く成功体験を生かし、半導体関連事業は飛躍する。（敬称略）



DNPはフォトマ
スクで世界トップ
級のシェアを握る

従来研究してきた

次世代半導体パッケージ向け部材「ガラスコア」の事業化を目指し、25年3月に新光電

気工業に出資した。平坦性や剛性を必要とする大型パッケージに開発を進める。

必要な技術を先回り
廣き、潮田が来たら
アリーハ提供できる

マスクではそれが
にすることが大事。

た」(同)。技術者の根付く成功体験を

躍する。（敬称略）